## 膜厚 30nm 以下の Ga 添加 Zn0 超薄膜の構造と電気特性効果

Structural and electrical properties of Ga-doped ZnO ultrathin films with thicknesses of below 30 nm

高知工科大総研<sup>1</sup>, 住友重機械(株)<sup>2</sup>, (株) リガク<sup>3</sup> <sup>O</sup>Palani Rajasekaran<sup>1</sup>, 北見尚久<sup>1,2</sup>, 小林信太郎<sup>3</sup>, 稲葉克彦<sup>3</sup>, 牧野久雄<sup>1</sup>, 山本哲也<sup>1</sup>

Kochi Univ. Tech., Res. Inst.<sup>1</sup>, Sumitomo Heavy Industries, Ltd.<sup>2</sup>, Rigaku Corp.<sup>3</sup>, <sup>°</sup>Rajasekaran Palani <sup>1</sup>, Hisashi Kitami<sup>1,2</sup>, Shintaro Kobayashi<sup>3</sup>, Katsuhiko Inaba<sup>3</sup>, Hisao Makino<sup>1</sup>, Tetsuya Yamamoto<sup>1</sup>

E-mail: palani.rajasekaran@kochi-tech.ac.jp

**緒言**: ウルツ鉱型結晶構造 Ga 添加 ZnO (GZO: Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含有量 4 wt.% 以下) 透明導電膜特性 (基板: 無アルカリガラス基板  $^1$ , ポリマー基板及び Si wafer  $^2$ ) の膜厚 t ( $\geq$  30 nm) 依存性  $^{1,2}$  に ついては機械特性  $^2$ をも含め報告を行ってきた. 課題は膜厚 100nm 以下の特性の設計制御を可能にする成膜技術である。 前回の応用物理学会では  $t \leq$  30 nm に焦点を絞って議論を行った  $^3$ 。本発表では主に  $t \leq$  30 nm GZO 薄膜の構造特性と機械特性との相関を議論する.

実験方法: 反応性プラズマ蒸着法 (住友重機械工業(株)社製) を用い,無アルカリガラス基板 (Corning EAGLE XG) 上に基板温度 200 ℃条件下にて GZO (原料:  $Ga_2O_3$  含有量 4 wt.% (ハクスイテック(株) 社製 SKY-Z) 薄膜を様々な膜厚 ( $10 \le t \le 200$  nm) において成膜した. base 圧力は  $6.25 \times 10^{-5}$  Pa とした. 成膜室に流す酸素 ( $O_2$ ) ガス流量 OFR は  $5 \le OFR \le 15$  sccm とした. 構造特性は X 線回折法 ((株)リガク社製 SmartLab) を用い、薄膜評価に有効な Out-of-plane Grazing-Incidence (GI) 及び in-plane XRD 法を用いた. 電気及び光学特性評価には、各々、室温下での van der Pauw 法による Hall 効果測定 (Nanometrics 社製 HL5500PC) 及び分光光度計 ((株)日立ハイテクサイエンス社製 HITACHI U4100) を用いた.

結果と考察:図1は薄膜  $10 \le t \le 200$  nm GZO 薄膜における格子歪み Strain<sup>3</sup>及び単位胞体積 V (V=Volume of wurtzite unit cell =  $3(3^{1/2}/2)l_a^2l_c$ :  $l_a$ 及び  $l_c$ は各々 a 軸及び c 軸格子定数) の t

依存性を示す。Out-of-plane GI 及び inplane XRD 測定による解析より GZO 薄膜は t や OFR に関係なく、ウルツ鉱型多結晶構造であり、強い c 軸配向性を有する柱状結晶子構造であることが明白となった。該 2 つの特性は同図より、t に関係なく OFR 増大と共に単位胞体積は減少し、歪みは増大することが判明した。この挙動は t=60 nm 前後で大きく 2 つのグループに分かれた。t  $\leq$  30 nm GZO 薄膜では  $1 \leq t/L$ (< 20 nm)  $\leq$  2  $^3$  である。この場合、ウルツ鉱型特有の 2 軸応力性のバランスが効かなくなり、単位胞体積の大きさの t 依存性が大きくなる。これは残留応力の t 依存性変動となることから薄膜

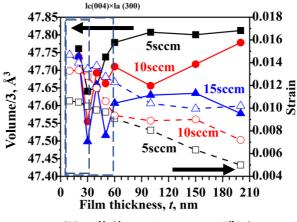


図 1 .体積 vs 歪みの GZO 膜厚 依存性

の可撓性(小さなヤング率)の制御領域となることが特徴となる.

## 参考文献

- (1) T. Yamada, A. Miyake, S. Kishimoto, H. Makino, N. Yamamoto, T. Yamamoto, Appl. Phys. Lett. 91, 051915 (2007).
- (2) N. Yamamoto, H. Makino, T. Yamamoto, Adv. Mater. Sci. Eng. doi:10.1155/2011/136127.
- (3) R. Palani, H Kitami, S Kobayashi, K Inaba, H Makino, T Yamamoto, JSAP spring meeting (2024), 25a-61A-4.